課題番号	:F-16-OS-0016
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:機能性酸化物を用いたナノ構造体作製と評価
Program Title (English)	: Fabrication of functional oxide nano-structures
利用者名(日本語)	: <u>神吉 輝夫</u> 、服部 梓、山本 真人、譚 ゴオン、頓田 佐映子、Wei Tingting、
	左海 康太郎、坪田 智司、中澤 密、李 明宇、近成 将司、林 慶一郎、樋口 敬之、
	辻 佳秀、川本 大喜、横川 隆信、Alexis Borowiak
Username (English)	: <u>T. Kanki</u> , A. Hattori, M. Yamamoto, W. Tingting, K. Sakai, T. Tsubota,
	H. Nakazawa, L. M. Yu, M. Chikanari, K. Hayashi, Y. Higuchi, Y. Tsuji,
	T. Kawamoto, T. Yokogawa, A. Borowiak
所属名(日本語)	:大阪大学 産業科学研究所
Affiliation (English)	:ISIR, Osaka University

<u>1. 概要(Summary)</u>

機能性酸化物薄膜のナノスケール化は、電子相転移 制御や量子効果等のナノ物性の興味に加え、低電力駆 動、高集積化に直結する重要な課題である。そこで、 我々は、酸化物トップダウン・ボトムアップナノテク ノロジーを融合した技術的方法論を確立し、酸化物ナ ノ構造の作製、及び新奇ナノエレクトロニクスの開拓 を行っている。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】

ナノインプリント装置(UV-NIL)、リアクティブイオ ンエッチング装置、MBE、イオンミリング装置 【実験方法】

上記装置群を用いて酸化物薄膜の微細加工を行った。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

■Mn 酸化物ナノ細線電気二重層液体トランジスタ

強相関電子系酸化物である (La,Pr,Ca)MnO3 (LPCMO)での相転移は数十-数百nmサイズの相分離 した強磁性金属相と電荷秩序型絶縁体相が担ってお り、絶縁体-金属転移 (IMT)発現の最小単位である 単一電子相の物性をデバイスとして制御した新奇ナ ノデバイス展開を目指して、50-100 nm 線幅の LPCMO ナノウォール細線をチャネルとした電気二 重層液体トランジスタ(EDLT)構造の創造を試みた。 Fig. 1(a)に線幅 80 nm のナノ細線 EDLT を示す。線 幅 80 nm の LPCMO ナノウォール細線をチャネルに 持つ FET の創製に成功した。

このナノ細線 EDLT のゲート電圧印加時のチャネ ルの抵抗の温度依存性(R-T)を Fig. 1(b)に示す。VG=0 Vでは 96 K で IMT が起きているが、-2 V 印加により



Fig. 1 (a) An EDLT structure with LPCMO nw channel. An inset shows 80 nm width LPCMO nw. (b) The RT curves for the LPCMO nw EDLT under 0 voltage (black) and -2 voltage application (white circle). 転移温度の高温シフト、抵抗変化率の減少が観測され た。今後はチャネルのナノ構造化の効果を明らかにし、 ナノデバイス展開への指針を得ていく。

■強相関物質/二次元半導体ヘテロ構造

強相関物質/二次元半導体ヘテロ構造は、新奇な電子・光機能を示す可能性があり、将来のデバイス基盤 として期待できる。本研究では、電子線リソグラフィ ー装置などの微細加工装置を利用し、350K 付近で金

属・絶縁体相転移を示す強 相関酸化物である二酸化 バナジウム(VO₂)と、二次 元層状半導体であるニセ レン化タングステン (WSe₂)とのヘテロ構造を 初めて作製した。Fig.2に 作製した WSe₂/VO₂ ヘテ ロ構造デバイスの光学顕 微鏡像と、電流電圧特性の 結果を示す。VO2 が絶縁状 態にある 300 K から金属 状態にある 380 K まで温 度を上昇させると、正バイ アスにおいてのみ抵抗値 が劇的に減少することが 分かった。この結果は、 **VO**₂ と適切な半導体を組 み合わせることによって、



Fig. 2 (a) An optical image and (b) current-voltage characteristics of a VO₂-WSe₂ heterostructure.

これまでにはない、整流性を有する金属・絶縁体相転移 デバイスを創製できることを意味しており、今後の電 子・光デバイス展開を期待させるものである。

4. その他・特記事項 (Others)

・関連する課題番号; S-16-OS-0012

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

H.Nakazawa et al, 第77回 応用物理学会春季学術講 演会, 平成28年9月15日

6. 関連特許(Patent)

なし。